接合イオンスライス LiNbO3 結晶におけるプロトン交換増速エッチング によるリッジ光導波路の作製 Fabrication of ridge waveguides in bonded ion-sliced LiNbO3 by proton-exchange accelerated etching ^の田中 圭祐, 栖原 敏明(阪大院工) [°]Keisuke Tanaka and Toshiaki Suhara (Grad. Sch. Eng., Osaka Univ.) E-mail: ktanaka@ioe.eei.eng.osaka-u.ac.jp

顕著な非線形光学効果を有する LiNbO₃(LN)に強光閉じ込め 導波路構造を形成することで,高効率な波長変換デバイスを実現 できる.我々は金属接合層表面活性化接合と,結晶表面にイオン を注入し薄膜結晶を剥離させるイオンスライシング法^[1]により MgO:LN 薄膜結晶を形成し,イオンビームエッチングを行うことで 微細リッジ導波路を作製した^[2].本研究では低損失強閉じ込め導 波路の簡便な作製法として,LN 結晶の Li⁺⇔H⁺プロトン交換(PE) 部において化学的エッチング速度が増加するプロトン交換増速エ ッチング法^[3]をイオンスライス結晶に適用し,Fig.1 のようなリッジ導 波路の作製を検討した.

等価屈折率法を用いてリッジ導波路の伝搬特性を求めた. 薄膜結晶の厚さを 0.67 µm, リッジ高さ・幅を 0.5 µm, 2.0 µm とし, 光波 長を 1.55 µm, 上部クラッド層, 導波層, SiO₂ バッファ層(厚さ 1.65µm), 金属接合層(Au)の屈折率を 1.55, 2.13, 1.45, 0.559-9.81i とした場合の TM₀₀モードの実効屈折率は 1.90 であり, 金属層による伝搬損失は約 0.02 dB/cm であることが分かった.

イオンスライス LN(0.67µm)/SiO₂(1.65µm)/Au(0.10µm)/LN(0.50 mm)(*NANOLN* 社製)上に電子ビーム描画によりレジストパターンを 形成し,リフトオフ法により Cr マスク(厚さ 0.10 µm,幅 2.0 µm)を 形成した. PE 中の保護のため端面近傍にSiO₂スパッタ堆積を行っ た後,200°C 溶融安息香酸中で PE を 36 分間行った.シリコーン グリスで端面を保護し、フッ硝酸エッチングを 2 時間行った結果, 高さ0.20 µm のリッジが得られた.表面の光学顕微鏡写真をFig. 2 に示す.試料と保護用結晶をBCBで貼り合わせ,導波路端面を研 磨した.断面の光学顕微鏡写真をFig. 3 に示す.

この薄膜結晶リッジ導波路(長さ7.0mm)に対し,端面結合法によ り波長 632.8 nmの垂直偏波光を結合し,倍率100倍,開口数0.60 の対物レンズを用いて CCD カメラ上に結像し,TM 導波モードを観 測した.近視野像を Fig. 4 に示す.半値全幅は厚さ方向約2.0 µm, 幅方向約3.0 µm であった. 今後,さらにエッチング深さを深くする ことで高いリッジを作製し,低損失強閉じ込め導波路を用いた高効 率波長変換デバイスの完成を目指す.

[1]P. Rabiei and P. Günter: Appl. Phys. Lett., 85 (2004) 4603.

[2]田中, 栖原, 第 60 回応用物理学会春季学術講演会, 29a-B3-1, 2013. [3]T. Takaoka, M. Fujimura, and T. Suhara: Electron. Lett., **45** (2009) 940.







Fig.2 Optical microscope photograph of top view of LN ridge waveguides.



Fig.3 Optical microscope photograph of cross section of LN ridge waveguide.



Fig. 4 Near field pattern of guided wave $(\lambda = 632.8 \text{ nm}, \text{TM mode}).$